

Gasses Used in Recipe	Material Etched (Mask)
CF4, O2	Si3N4 (SPR 220 3.0 PR)
Ar	LiNbO3 (SiO2)
CF4, O2	SiO2 (950 PMMA A4), (PMMA)
Cl2, O2	CrSBr (SiO2)
Ar	Si Test Wafer (No Mask)
Ar	Si (SPR 220 3.0)
CF4, O2	Si (SPR 220 3.0)
CF4, O2	Si Test Wafer (No Mask)
BCl3, CF4, Ar	TiO2 (SiO2)